

第3回ISIT産学連携先導プログラム
第50回未来化学創造センターセミナー



日時：2010年1月12日(火) 15時00分～16時00分
会場：九州大学伊都キャンパス W4号館423号室

< 参加無料 >

講演者：

Key Laboratory of Advanced Display and System Applications,
Ministry of Education, Shanghai University

Ms. Bo LI

題目： Wet Process in Producing of OLED

講演内容：

- I. Performance improvement of POLED with CBP layer
- II. Chromatic-stable and controllable WOLED using CCM method
- III. Comparison of WOLED using MEH-PPV as CCM and CC-HIL respectively

略歴：

2004 - 2007 Nankai University
2007 - Present Shanghai University

主催：(財)九州先端科学技術研究所(ISIT)

(連絡先：新産業支援室 八尋 正幸

E-mail:yahiro@isit.or.jp、TEL:092-805-3810)

共催：九州大学未来化学創造センター

(連絡先：安達千波矢

E-mail:adachi@cstf.kyushu-u.ac.jp、TEL:092-802-3306)